

2026年4月20日
株式会社ニューフレアテクノロジー

国際シンポジウム「Photomask Japan 2026」に参加

ニューフレアテクノロジー(NFT)は、2026年4月8日から10日までパシフィコ横浜アネックスホールで開催された「Photomask Japan 2026」に参加しました。

本学会は、ホトマスクジャパンとSPIE（国際光工学会：The International Society for Optical Engineering）が毎年開催する国際シンポジウムで、フォトマスクおよび次世代リソグラフィーマスク技術について、幅広い報告が行われました。

NFTは、特別イベント企画「チュートリアル」の「描画」セクションの講演を担当しました。また、マルチ電子ビームマスク描画装置MBM™-4000に関する最新の研究成果についてOralで1件、Posterで1件、計2件の発表を行っています。

〈 Photomask Japan 2026 での NFT の口頭発表／ポスター発表〉

Tutorial: Drawing

Presentation Title: A History of E-Beam Mask Writers and Their Role in Semiconductor Manufacturing

Speaker: Rieko Nishimura

Oral Presentation

Writing and Patterning 14-3

Presentation Title: Multi-beam Mask Writer MBM™-4000: Enhancements and Latest Performance

Presenter: Yusuke Saito

Poster Presentation

10-40

Presentation Title: Resist Heating Effect Correction in Multi-beam Mask Writer MBM™-4000

Presenter: Haruyuki Nomura

関連リンク：

[Photomask Japan 2026 | HOME](#)

以上